

300X300Mm 가열 플레튼과 Pid 제어를 갖춘 30톤 분리형 자동 실험실 핫 프레스

품목 번호: XP40



소개

300x300mm 가열 플레튼, PID 온도·압력 제어, 5단계 프로그램 가능 레시피, 수냉식 듀얼 존 독립 가열 기능을 갖춘 30톤 분리형 자동 실험실 핫 프레스입니다. 표준 300°C 버전과 고온 500°C 버전으로 제공되며, 배터리 연구 및 정밀 시료 준비에 이상적이며 CE 인증을 받았습니다.

자세히 알아보기

응용 분야	설명	주요 이점
배터리 전극 캘린더링	제어된 열과 압력을 사용하여 코팅된 전극 호일을 정밀하게 압축하여 코팅 후 목표 기공률과 두께를 달성합니다.	에너지 밀도를 높이고 접착력을 개선하여 전지 조립 시 바리를 줄입니다.
고체 전해질 고화	유리-세라믹 또는 황화물 기반 전해질 분말을 전고체 전지용 고밀도 펠릿 또는 박막으로 가공합니다.	높은 이온 전도도와 낮은 계면 저항에 중요한 이온 밀도에 가까운 밀도를 달성합니다.
고분자 멤브레인 제조	연료전지 멤브레인 또는 의료 기기 부품용으로 열가소성 고분자를 제어된 두께의 균일한 필름으로 핫 프레스합니다.	핀홀을 없애고 일관된 기계적 및 수송 특성을 보장합니다.
세라믹 기판 생산	세라믹 테이프를 적층하고 압력 하에서 소결하여 전자 패키징용 평평한 고강도 기판을 생산합니다.	힘을 최소화하고 우수한 열전도율을 가진 기판을 생산합니다.
복합 재료 개발	프로그래밍 가능한 열과 압력 하에서 탄소 섬유 강화 프리프레그 또는 금속-기지 복합재를 고화시킵니다.	최적화된 섬유 부피 분율과 낮은 보이드 함량을 가진 고성능 부품을 생산합니다.
미세 구조 핫 엠보싱	가열 플레튼과 정밀 압력을 사용하여 고분자 또는 유리 기판에 마이크로 또는 나노 스케일 패턴을 복제합니다.	미세유체 칩과 광학 격자의 비용 효율적인 프로토타이핑을 가능하게 합니다.
제약 정제 제제	제어된 온도 하에서 부형제 성능을 연구하고 제제를 최적화하기 위해 생산 규모의 정제 압축을 시뮬레이션합니다.	소량의 시료로 제제 개발을 가속화합니다.
지질 시료 준비	고압 고온 하에서 암석 분말을 균질한 유리 디스크로 압축하여 XRF 분석용 용융 비드를 형성합니다.	입자 크기 효과를 제거하여 분석 정확도를 향상시킵니다.

매개변수	XP40-S (표준)	XP40-H (고온)
최대 압력	0-30톤	0-30톤
플레튼 크기	300 × 300 mm	300 × 300 mm
작동 온도	0-300°C	0-500°C
가열 전력	6,000 W (2 × 3,000 W)	6,000 W (2 × 3,000 W)
온도 제어	PID 프로그램 가능 컨트롤러	PID 프로그램 가능 컨트롤러
압력 제어	PID 폐쇄 루프 자동 압력 유지	PID 폐쇄 루프 자동 압력 유지
피스톤 스트로크	50 mm	50 mm
최대 테이라이트	150 mm	150 mm

매개변수	XP40-S (표준)	XP40-H (고온)
냉각 방식	순환 수냉식 (외부 칠러 호환)	순환 수냉식 (외부 칠러 호환)
제어 인터페이스	7인치 산업용 터치스크린	7인치 산업용 터치스크린
전원 공급	AC 220-240 V, 단상, 50/60 Hz (전용 32 A 차단기 필요)	AC 220-240 V, 단상, 50/60 Hz (전용 32 A 차단기 필요)
치수 (본체)	700 × 400 × 600 mm	700 × 400 × 600 mm
순중량	약 280 kg	약 290 kg
인증	CE	CE